9. 高周波線路の電流分布特性

1. 目的

高周波帯における信号伝送特性について理解するため、プリント線路上の磁界測定から電流を推定し、定在 波分布について考察する。

2. 高周波帯における線路上の電流分布

2-1. 分布定数回路における電圧と電流

高周波を扱う回路では、信号波長の大きさによって集中定数回路と分布定数回路に分けられる。ある信号の周波数をf、信号の伝搬速度をvとすると、波長λは以下の式で表される。

 $\$ \lambda = \frac{v}{f} \quad (1) \$\$

波長Aよりも十分に短い線路を集中定数回路、波長Aと同等もしくは短い線路を分布定数回路として取り扱う。

伝送線路には、平行銅線や同軸ケーブルなど、様々な形のものがある。導体には抵抗やインダクタ成分などの寄生成分が存在する。導体間にはキャパシタ成分や、微小な漏れ電流も考えられる。単位長さ当たりの抵抗R、インダクタンスL、線間のキャパシタC、コンダクタンスをGとする。代表的な平行導線について、微小区間ごとに区切り寄生成分やそれによる電圧の変化について考える。分布定数線路内における寄生成分を図1に示す。ここで、\$v s\$ および50Ωは入力電圧と入力抵抗であり、\$Z L\$ は終端負荷である。

伝送線路内を伝搬する伝搬定数 \$\gamma\$ は

 $\$ \gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} \quad (2) \$\$

として表される。一方、特性インピーダンス \$Z_0\$ は以下の式により求められ、無損失線路ではLとCのみで表される。

 $S Z_0 = \sqrt{R+j\omega G+j\omega G} \$

伝送線路を伝搬する信号は、進行波と反射波の合成により成り立つ。式(4)に距離xにおける電圧と電流を示す。

ここで、\$e^{+\gamma x}\$ の項は進行波を表しており、\$e^{-\gamma x}\$の項は反射波を表している。オイラーの公式(双曲線関数の定義)

 $\$ \cosh(\gamma x) = \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2}, \quad x) = \frac{e^{-\gamma x}}{2} \quad x) = \frac{e^{

を用いると、伝送線路の基礎方程式は式(6)のように表される。

 $\$ \begin{pmatrix} V(x) \ I(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma x) & -Z_0 \sinh(\gamma x) \ - \frac{1}{Z_0}\sinh(\gamma x) & \cosh(\gamma x) \end{pmatrix} \ \partix} \quad (6) \$\$

線路終端において、特性インピーダンス Z_0 と終端負荷 Z_L が不整合の場合、進行してきた波は Z_L で吸収されず反射する。反射係数 G_L は式(7)により表される。

 $\$ \Gamma_L = \frac{v_0^-}{v_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (7)

反射係数を用いて、距離xにおける電圧と電流は式(8),(9)となる。

 $|V(x)| = |v_i^+| |1 + |Gamma_L| e^{-j(\phi + 2\phi x)}| \quad (8) $$ $$ |I(x)| = \frac{|v_i^+|}{|Z_0|} |1 - |Gamma_L| e^{-j(\phi + 2\phi x)}| \quad (9) $$$

終端の負荷条件により、反射波の大きさが変化する。例えば、終端開放の場合は反射係数 \$\Gamma_L=1\$ となり、正の波が反射する。一方、短絡の場合は、反射係数 \$\Gamma_L=-1\$ となり、負の波が反射する。反射波は進行波と合成され、定在波が分布する。

特性インピーダンスとの不整合は、負荷へのエネルギー供給効率の低下となり、定在波はコモンモードによるノイズ放射の原因となり、高周波(MHz~GHz) 帯で対策が必要となる。

2-2. マイクロストリップ線路

高周波回路にはプリント基板が用いられる。裏面が全面銅箔 (GND)で、表面に信号線路がある基板をマイクロストリップ線路という。マイクロストリップ線路における特性インピーダンス \$Z 0\$ は、

 $Z_0 = \frac{87.0}{\sqrt{psilon_r + 1.41}} \ln\left(\frac{5.98H}{0.8W + T}\right) \quad (10)$

により求められる [1]。ここで、Wは線路幅、Hは基板の厚さ、Tは線路銅箔の厚さ、\$\epsilon_r\$ は4.4 (公称)である。

2-3. 近磁界プローブ

プリント基板上の電流分布は、構造上の問題から直接測定することができない。このため、プリント線路上 の磁界を測定することで、等価的に電流分布を推定する方法が用いられる。

線路から発生した磁界が磁界プローブに鎖交することで、プローブ端に誘導起電力が発生する。この検出電圧Vをスペクトラムアナライザで測定することで、磁界測定が可能となる。磁界プローブは、波長よりも十分短い微小磁界プローブが一般的に用いられる。これは、広帯域で連続的磁界測定が可能となるためである。

スペクトラムアナライザで測定される値は検出電圧Vであるため、磁界Hに換算する必要がある。電圧Vにアンテナ係数 (AF) を掛け合わせることで磁界Hに変換できる [2]。

 $$H = AF \cdot V \quad [\text{A/m}] \quad (11) $$

電磁界測定の場合、測定値はdBで測定する場合が多いため、dB表記では式(12)のようになる。

 $$$ H = AF + V \qquad [\text{dB}\mu A/m] \qquad (12) $$$

4. 実験方法

(1) 使用機器を揃える。

スペクトラムアナライザ、磁界プローブ (NEC:CP-2S)、3軸ステージ、プリント基板、同軸ケーブル(×2)

- (2) 3軸ステージの同軸ケーブルに磁界プローブをセットする。同軸ケーブルはスペクトラムアナライザの RFIN に接続する。
- (3) 3軸ステージにプリント基板(開放)を設置する。プリント基板のSMAコネクタとスペクトラムアナライザのTGを同軸ケーブルに接続する。
- (4) スペクトラムアナライザを以下の通りセットする。

Center Frequency: 1 GHz, Span: 10 MHz, BW: 10 kHz, Sweep: auto

Reference:(最初の確認作業では) 107 dBμV, (測定時は) 87dBμV に変えて, Pre amp.をON, Attenuation: 0dB, TG 出力:107dBμV.

- (5) 磁界プローブをプリント線路終端位置にあわせる。この際、100mm 移動させるため、3軸ステージのx軸を右側に移動させておくこと。また、プローブ先端は基板上1mm になるようにセットする。※プリント線路の両端の高さを可能な限り同じ高さに(水平に)する。0.1mm以下のずれにすること。
- (6) 5mm間隔でデータを読む。ただし、定在波の節の部分は細かく読むこと。
- (7) プリント基板(短絡)、(整合)、(負荷) に交換して同様の実験を行う。
- (8) 測定値にアンテナ係数 AFをかけて磁界に変換する。

ここで、校正係数は次式で表される[2]。

 $\$\$ AF = -8.1 \ln f + 106.2 \$\$$

※fは MHz オーダーで計算すること。例) 1GHzはf=1000で計算する。

5. 報告事項

- (1) 測定結果より波長A、伝搬速度vを算出しなさい。速度vが光速よりも遅くなる理由について述べなさい。
- (2) プリント基板 (負荷)の結果より、定在波比SWRを求めなさい。
- (3) 反射係数を求めなさい。また、接続した負荷抵抗の値を算出しなさい。
- (4) 終端開放と短絡させた線路の入力インピーダンスを導出しなさい。両者を掛け合わせることで線路の特性インピーダンスが求められることを証明しなさい。

参考文献

- [1] Mark I. Montrose著, 出口・田上共訳、プリント基板のEMC 設計, P.95, オーム社.
- [2] 磁界プローブ CP-2S 取扱説明書, NEC